

(19) 대한민국특허청(KR)  
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. <sup>6</sup> H01L 21/304	(11) 공개번호 (43) 공개일자	특 1997-0077282 1997년 12월 12일
(21) 출원번호	특 1996-0018521	
(22) 출원일자	1996년 05월 29일	
(71) 출원인	삼성전자 주식회사 김광호	
(72) 발명자	경기도 수원시 팔달구 매탄동 416번지 박재균 경기도 용인군 기흥읍 고매리 세원아파트 102동 202호 최영준	
(74) 대리인	서울특별시 송파구 신천동 11-9 한신코아아파트 826호 이영필, 권석흠, 노민식	

**심사청구 : 있음**

(54) 반도체 기판 세정 용액

**요약**

본 발명은 반도체 기판 세정 용액에 관한 것이다. 하기 식(1)로 표시되는 불화암모늄, 불산 및 탈이온수를 포함하는 세정 용액을 이용하면, 현상 공정 후에 표면에 남아 있는 유기 물질을 효과적으로 제거할 수 있다.



여기에서, R은 C<sub>2</sub>~C<sub>18</sub>탄화수소임.

**명세서**

[발명의 명칭]

반도체 기판 세정 용액

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

**청구항 1**

하기 식(1)로 표시되는 불화암모늄, 불산 및 탈이온수를 포함하는 것을 특징으로 하는 반도체 기판 세정용액.



여기에서, R은 C<sub>2</sub>~C<sub>18</sub>탄화수소임.

**청구항 2**

제1항에 있어서, 상기 불화암모늄의 함유량은 상기 불산 1몰에 대하여 2내지 7몰인 것을 특징으로 하는 반도체 기판 세정 용액.

**청구항 3**

제1항에 있어서, 상기 탈이온수는 상기 불화암모늄 및 불산의 총중량에 대하여 100중량% 이하인 것을 특징으로 하는 반도체 기판 세정 용액.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.